

水素水製造装置

KHOW[®] SYSTEM HS型



ウェットプロセスに革命！ 環境負荷の少ない洗浄を実現！！
抜群の微粒子除去効果

特長

- ・高濃度の溶存水素濃度を実現
超純水を脱気した後、水素ガスを溶解するシステムを採用することで、効率的に水素ガスを溶解できます。微量のアンモニアを加え、超音波洗浄と組み合わせることで、微粒子を除去します。
- ・濃度追従機能による安定供給
水素ガスを超純水の流量に追従させたことで、安定した溶存水素濃度の水素水が供給可能です。
- ・薬品使用量の大幅削減で環境負荷を低減
SC1などの薬品洗浄の代替として使用できるので、環境負荷を低減します。また、排水負荷が低減するので、排水コストを削減できます。
- ・ボタンひとつで全自動運転
装置の運転状態はタッチパネルに集中表示されるので、運転管理が容易です。

用途

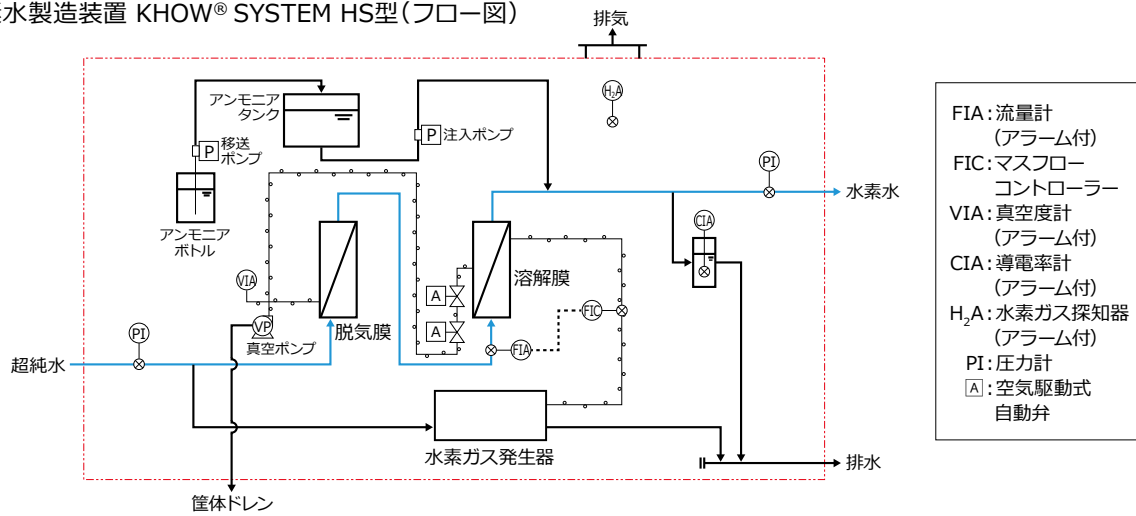
半導体・ウェハ／薬品洗浄後リンス・最終リンス
ディスプレイ(液晶・有機EL)／メガソニックでの各洗浄
フォトマスク・ハードディスク／微粒子除去洗浄

※QRコードからKCRセンターのホームページに掲載している製品情報ページをご覧ください。



フロー図

水素水製造装置 KHOW® SYSTEM HS型(フロー図)



仕様表

型式	HS-10D	HS-20C	HS-40C	HS-60C	
水素水流量[L/min]	10	20	40	60	
主な給水条件	超純水				
溶存水素濃度[mg/L]	1.2以上				
一次電源	AC100V × 1φ×50/60Hz			AC200V / 220V × 3φ × 50/60Hz	
電源容量[kVA]	2			2	
外形寸法[mm]	幅	850	850	900	1100
	奥行	800	800	1000	1200
	高さ	1850	1850	1850	1850
製品重量[kg]	350	360	400	500	
運転重量[kg]	450	480	500	600	

屋内仕様になります。

両用機(水素水+オゾン水)、セントラル方式(大型装置、工場一括供給)のご相談は、別途お問い合わせください。

窒素水(パターン倒壊抑制)、炭酸水(基板帯電防止)のご相談は、別途お問い合わせください。

本カタログで使用している商標(製品名・サービスおよびロゴ)は、当社が使用を認めた権利者に帰属しますので、無断で使用することはできません。

改良のため、予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

警告 据付、取付、取外し、保守等については取扱説明書の注意事項を必ず守ってください。

2018年4月1日現在

 **栗田工業株式会社**

〒164-0001
東京都中野区中野四丁目10番1号 中野セントラルパーク イースト
<http://www.kurita.co.jp>

水処理のご相談は「KCRセンター」まで

 **0120-40-7474**

<http://kcr.kurita.co.jp/>